

# 研究者・技術者の夢を実現するスパッタ装置

## EB1000

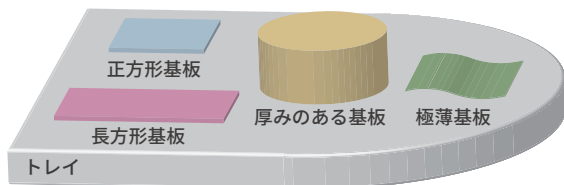


実験・研究開発に最適なスパッタ装置  
教育用装置としてもお勧め

### 特長

- ・小径(φ 2")カソードで最大3円同時成膜が可能
- ・トレイ搬送により多種多様な基板に対応可能
- ・小スペースに設置可能

**全部成膜可能です！**



## EB1100

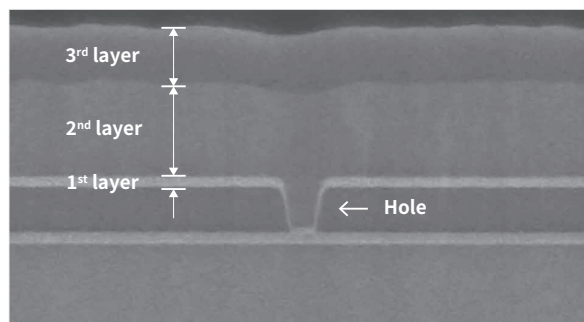


高温成膜や低温成膜も可能なスパッタ装置  
研究から少量生産まで対応

### 特長

- ・φ 4"(最大4基)、φ 12.5"(1基)カソードに多種多様なターゲットを搭載可能
- ・トレイ搬送により多種多様な基板に対応可能
- ・搬送から成膜まで全自動運転

**埋め込み成膜も可能です！**



提供: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所  
ナノカーボンデバイス研究センター

大学、研究所など多数納入実績あり

# 先端半導体生産を支える薄膜形成加工技術

## 幅広いプロセス要求に応える装置群

**FC7100/NC7900**     $\varnothing 200 / \varnothing 300$  mm



**特長**

- ・膜質の安定性を確保した反応性スパッタが可能
- ・最大32材料の積層を超高真空環境で一貫成膜が可能

**NC8000**     $\varnothing 200 / \varnothing 300$  mm



**特長**

イオンビームエッチング、後酸化、パッシベーション成膜の連続処理が可能

**IC7500**     $\varnothing 300$  mm



**特長**

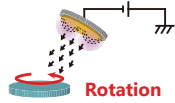
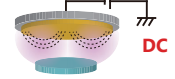
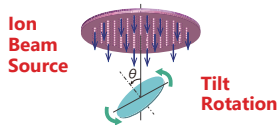

配線工程に最適な高い生産性と安定性を備えたスパッタ装置

**BC7000/BC7300**     $\varnothing 100 \sim \varnothing 300$  mm



**特長**

材料を選ばない無加熱・無加圧の接合が可能

テクノロジー	適用例	詳細	装置
極薄膜の積層	ロジック 不揮発性メモリ イメージセンサー	原子レベル膜厚制御性と優れた均一性を実現するスパッタ	 Rotation <b>FC7100 NC7900 NC7940</b>
高スループット	ロジック DRAM パワーデバイス 実装	独自マグネット制御機構搭載 平行平板スパッタ	 DC <b>IC7500</b>
高被覆性		高周波 (60 MHz) イオン化スパッタ	
難エッチング材 特殊形状加工	不揮発性メモリ 実装	広角チルトホルダ搭載 イオンビームエッチング	 Ion Beam Source Tilt Rotation <b>NC8000</b>
常温ウェハー 接合	接合プロセス全般	原子拡散接合法による 無加熱・無加圧接合	 Bonding <b>BC7000 BC7300</b>